

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】 第 6 部門第 2 区分
 【発行日】 平成 18 年 6 月 1 日 (2006.6.1)

【公開番号】 特開 2005-140836 (P2005-140836A)
 【公開日】 平成 17 年 6 月 2 日 (2005.6.2)
 【年通号数】 公開・登録公報 2005-021
 【出願番号】 特願 2003-374435 (P2003-374435)
 【国際特許分類】

G 0 2 F 1/1343 (2006.01)
G 0 2 F 1/1333 (2006.01)
G 0 2 F 1/1335 (2006.01)
G 0 2 F 1/1337 (2006.01)
G 0 9 F 9/35 (2006.01)

【F I】

G 0 2 F 1/1343
 G 0 2 F 1/1333 5 0 5
 G 0 2 F 1/1335
 G 0 2 F 1/1337 5 2 5
 G 0 9 F 9/35

【手続補正書】
 【提出日】 平成 18 年 4 月 10 日 (2006.4.10)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】 特許請求の範囲
 【補正対象項目名】 全文
 【補正方法】 変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

透明導電膜と光学薄膜との積層膜により構成された画素電極を備え、前記画素電極を透過する光により画像表示を行なう透過光表示領域を有する電気光学装置であって、
 前記透明導電膜と前記光学薄膜との干渉により、前記透明導電膜と前記光学薄膜との積層膜の可視光領域の透過率が、前記透明導電膜の可視光領域の透過率よりも高められたことを特徴とする電気光学装置。

【請求項 2】
 前記透明導電膜は、ITO 膜であることを特徴とする請求項 1 に記載の電気光学装置。

【請求項 3】
 前記光学薄膜は、窒化膜であることを特徴とする請求項 1 に記載の電気光学装置。

【請求項 4】
 前記窒化膜は、プラズマ窒化膜、プラズマ酸窒化膜、窒化シリコン膜及びシリコン酸窒化膜のいずれか一つであることを特徴とする請求項 3 に記載の電気光学装置。

【請求項 5】
 前記光学薄膜は、前記透明導電膜と同等の屈折率を有することを特徴とする請求項 1 に記載の電気光学装置。

【請求項 6】
 前記光学薄膜は、550nm 近傍の中波長域において高い透過率を有することを特徴とする請求項 1 に記載の電気光学装置。

【請求項 7】
 前記透明導電膜と光学薄膜とは夫々多層構造を有することを特徴とする請求項 1 に記載

の電気光学装置。

【請求項 8】

対向配置された一对の基板と、

前記一对の基板間に封入する液晶層と、

透明導電膜と光学薄膜とが積層されて構成され、前記透明導電膜と前記光学薄膜との干渉により、可視光領域の透過率が前記透明導電膜の可視光領域の透過率よりも高められた積層膜と、

前記透明導電膜と前記液晶層との間に夫々設けられる配向膜とを具備したことを特徴とする液晶装置。

【請求項 9】

基板上に、透明導電膜と光学薄膜との積層膜のうちの光学薄膜を形成する工程であって、前記透明導電膜と前記光学薄膜との干渉により、可視光領域の透過率を前記透明導電膜の可視光領域の透過率よりも高めるための工程と、

前記光学薄膜に前記透明導電膜を積層する工程とを具備したことを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【請求項 10】

基板上に、透明導電膜と光学薄膜との積層膜のうちの光学薄膜を形成する工程であって、前記透明導電膜と前記光学薄膜との干渉により、可視光領域の透過率を前記透明導電膜の可視光領域の透過率よりも高めるための工程と、

前記光学薄膜に前記透明導電膜を積層する工程と、

前記透明導電膜上に配向膜を形成する工程とを具備したことを特徴とする液晶装置の製造方法。

【請求項 11】

前記光学薄膜は、配向膜と兼用することを特徴とする請求項 1 乃至 7 に記載の電気光学装置

【請求項 12】

前記光学薄膜は、マイクロレンズの少なくとも片側の面に積層されることを特徴とする請求項 1 乃至 7 に記載の電気光学装置

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0012】

本発明に係る電気光学装置は、透明導電膜と光学薄膜との積層膜により構成された画素電極を備え、前記画素電極を透過する光により画像表示を行なう透過光表示領域を有する電気光学装置であって、前記透明導電膜と前記光学薄膜との干渉により、前記透明導電膜と前記光学薄膜との積層膜の可視光領域の透過率が、前記透明導電膜の可視光領域の透過率よりも高められたことを特徴とする。

また、本発明に係る電気光学装置において、前記光学薄膜は、窒化膜であることを特徴とする。

また、本発明に係る電気光学装置において、前記窒化膜は、プラズマ窒化膜、プラズマ酸窒化膜、窒化シリコン膜及びシリコン酸窒化膜のいずれか一つであることを特徴とする。